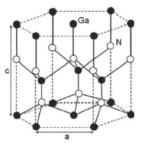
作业 1

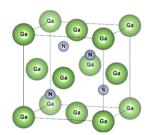
廖汶锋

2024年3月9日

1.1. GaN 材料由 N 原子(原子量 14,80pm)和 Ga 原子(原子量 69.723,135pm)按原子数 1:1 构成。GaN 晶体有两种类型,一种是 纤锌矿型结构,其晶格常数的公认值为 a=0.3189nm, c=0.5185nm,其结构如下图所示;另一种是闪锌矿型结构,其晶格常数的公认值为 0.452nm。分别计算二者的密度,并进行比较。



(a) 纤锌矿结构



(b) 闪锌矿结构

解. 对于纤锌矿结构,每一个晶胞包含 6 个 Ga 原子和 6 个 N 原子,所以利用密度公式【此处 a=0.3189nm】

$$\rho_{\text{GaN},wurtzite} = \frac{6\left(\frac{M_{\text{Ga}} + M_{\text{N}}}{N_A}\right)}{6 \cdot \frac{1}{2}a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot c}$$

$$= \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\left(M_{\text{Ga}} + M_{\text{N}}\right)/N_A}{a^2c}$$
(1.1-1)

解得 $\rho_{\text{GaN},wurtzite} = 6.091 \text{g/cm}^3$.

对于闪锌矿结构,每一个晶胞包含 4 个 Ga 原子和 4 个 N 原子,所以利用密度公式【此处 $a=0.452\mathrm{nm}$ 】

$$\rho_{\text{GaN},zincblende} = \frac{4\left(\frac{M_{\text{Ga}} + M_{\text{N}}}{N_A}\right)}{a^3}$$
(1.1-2)

解得 $\rho_{\text{GaN},zincblende} = 6.024 \text{g/cm}^3$ 。

对比两种结构的 GaN 晶体, 纤锌矿结构的密度略大于闪锌矿结构。

1.2. 已知温度为 300K 时, Si 的晶格常数为 5.431Å, GaAs 的晶格常数为 5.653Å。分别计算 Si、GaAs 的 {100}、{110}、{111} 面的面间距。

解. 因为 Si 是金刚石结构,可以看成是两个面心立方沿着体对角线滑移 1/4 嵌套而成,所以 {100} 和 {110} 都是由单原子层所组成的晶面。

$$d_{100,Si} = a_{Si}/4 = 1.358\text{Å}$$
 (1.2-1)

$$d_{110,Si} = a_{Si}/2\sqrt{2} = 1.920\text{Å}$$
 (1.2-2)

但是 {111} 是由一个 Si 原子及其滑移 (1/4,1/4,1/4) 的 Si 原子所组成的双原子层, 所以其面间距刚好等于单个面心立方的 {111} 面间距。

$$d_{111,Si} = a_{Si}/\sqrt{3} = 3.136\text{Å}$$
 (1.2-3)

另一方面, GaAs 是闪锌矿结构, 所以可以看成是由 Ga 原子和 As 原子分别组成的两个面心立方沿着体对角线滑移 1/4 嵌套而成。因此, 其布拉菲格子就是面心立方。

$$d_{100,\text{GaAs}} = a_{\text{GaAs}}/2 = 2.8265\text{Å}$$
 (1.2-4)

$$d_{110,\text{GaAs}} = a_{\text{GaAs}}/2\sqrt{2} = 1.9986\text{Å}$$
 (1.2-5)

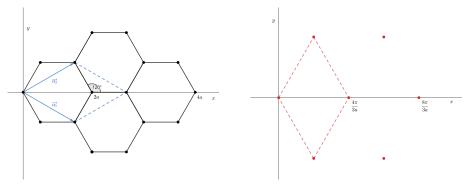
$$d_{111,\text{GaAs}} = a_{\text{GaAs}} / \sqrt{3} = 3.2638 \text{Å}$$
 (1.2-6)

- 1.3. 近年来, 硅烯、磷烯等新型材料备受关注。与石墨烯类似, 硅烯也为单层蜂窝状网格结构, 设晶格常数为 *a*。
 - (a) 晶体的二维晶格为布拉菲格子还是复式格子? 画出其原胞的一种示意图,并给出原胞基矢的向量表示。规定: *x* 轴正方向为水平向右, *y* 轴正方向为竖直向上。
 - (b) 计算倒格子基矢,观察倒格子对应的格点图,你有什么结论?
 - (c) 画出第一布里渊区, 并求其面积。
 - (d) 假设相邻硅原子间的键长为 1.69Å, 计算其面密度。
 - 解. (a) 单层蜂窝状网格结构就是复式格子。题目所求的原胞示意图 如图 2a 所示。此时,原胞基矢为

$$\begin{cases}
\overrightarrow{a_1} = \sqrt{3}a \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \overrightarrow{i} - \frac{1}{2} \overrightarrow{j} \right) \\
\overrightarrow{a_2} = \sqrt{3}a \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \overrightarrow{i} + \frac{1}{2} \overrightarrow{j} \right)
\end{cases}$$
(1.3-1)

(b) 不妨设 $\overrightarrow{a_3} = \overrightarrow{k}$, 所以倒格子基矢为

$$\begin{cases}
\overrightarrow{b_1} = 2\pi \frac{\overrightarrow{a_2} \times \overrightarrow{a_3}}{\overrightarrow{a_1} \cdot (\overrightarrow{a_2} \times \overrightarrow{a_3})} = \frac{4\pi}{3a} \left(\frac{1}{2} \overrightarrow{i} - \frac{\sqrt{3}}{2} \overrightarrow{j} \right) \\
\overrightarrow{b_2} = 2\pi \frac{\overrightarrow{a_3} \times \overrightarrow{a_1}}{\overrightarrow{a_2} \cdot (\overrightarrow{a_3} \times \overrightarrow{a_1})} = \frac{4\pi}{3a} \left(\frac{1}{2} \overrightarrow{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \overrightarrow{j} \right)
\end{cases} (1.3-2)$$



- (a) 硅烯的二维晶格结构和原胞示意图
- (b) 硅烯的倒格子点阵

对比硅烯的正格子点阵和倒格子点阵,可以发现倒格子点阵逆时 针旋转 90°后,与正格子点阵相似。

(c) 题目所求的第一布里渊区如图 3所示,为倒格子点阵的维格纳-赛 茨 (W-S) 原胞。其面积为等于原胞面积 = $||\overrightarrow{b_1} \times \overrightarrow{b_2}|| = \frac{8\sqrt{3}\pi^2}{9a^2}$

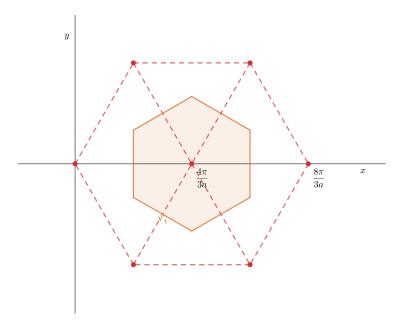


图 3: 硅烯的第一布里渊区

半导体能带工程 清华大学

(d) 硅烯的原胞包含 2 个 Si 原子,原胞面积 = $||\overrightarrow{a_1} \times \overrightarrow{a_2}|| = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$ 。 所以硅烯的原子面密度

$$\sigma_{silicene} = \frac{2}{\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2} = \frac{4\sqrt{3}}{9a^2} = 2.6953 \times 10^{15} \text{cm}^{-2}$$
 (1.3-3)

质量面密度

$$\rho_{silicene} = \frac{M_{Si}}{N_A} \cdot \sigma_{silicene} = 1.2575 \times 10^{-7} \text{g/cm}^2$$
 (1.3-4)